

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成28年3月3日(2016.3.3)

【公開番号】特開2014-136182(P2014-136182A)

【公開日】平成26年7月28日(2014.7.28)

【年通号数】公開・登録公報2014-040

【出願番号】特願2013-5195(P2013-5195)

【国際特許分類】

B 05 D 3/10 (2006.01)

B 05 C 11/10 (2006.01)

B 05 C 11/08 (2006.01)

B 05 D 1/40 (2006.01)

H 01 L 21/027 (2006.01)

【F I】

B 05 D 3/10 Z

B 05 C 11/10

B 05 C 11/08

B 05 D 1/40 A

H 01 L 21/30 5 6 4 C

【手続補正書】

【提出日】平成28年1月13日(2016.1.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

薬液を回転塗布することで基板表面に薬液層を形成する方法であって、

薬液の回転塗布中に基板外部に排出される余剰の薬液が固形化し、綿菓子状の薬液が発生し得る領域に対して、前記薬液を除去する薬液除去溶剤を噴霧する薬液層の形成方法。

【請求項2】

薬液除去溶剤を2流体ノズルにより噴霧する請求項1に記載の薬液層の形成方法。

【請求項3】

薬液除去溶剤を超音波ノズルにより噴霧する請求項1に記載の薬液層の形成方法。

【請求項4】

少なくとも基板端部に対して薬液除去溶剤を噴霧する請求項1から3のいずれか1項に記載の薬液層の形成方法。

【請求項5】

前記薬液除去溶剤の噴霧は、前記基板表面の裏側の面である基板裏面の側から行う請求項1から4のいずれか1項に記載の薬液層の形成方法。

【請求項6】

前記薬液はレジストである請求項1から5のいずれか1項に記載の薬液層の形成方法。

【請求項7】

薬液を回転塗布することで基板表面に薬液層を形成する薬液層の形成装置であって、
基板回転機構と、

基板表面に薬液を塗布する薬液塗布機構と、

薬液の回転塗布中に基板外部に排出される余剰の薬液が固形化し、綿菓子状の薬液が発

生し得る領域に対して、前記薬液を除去する薬液除去溶剤を噴霧可能な薬液除去溶剤噴霧機構と、を備える薬液層の形成装置。

【請求項 8】

前記薬液除去溶剤噴霧機構が2流体ノズルである請求項7に記載の薬液層の形成装置。

【請求項 9】

前記薬液除去溶剤噴霧機構が超音波ノズルである請求項7に記載の薬液層の形成装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

本発明に係る薬液層の形成方法は、薬液を回転塗布することで基板表面に薬液層を形成する方法であって、薬液の回転塗布中に基板外部に排出される余剰の薬液が固形化し、綿菓子状の薬液が発生し得る領域に対して、前記薬液を除去する薬液除去溶剤を噴霧する。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

本発明に係る薬液層の形成装置は、薬液を回転塗布することで基板表面に薬液層を形成する薬液層の形成装置であって、基板回転機構と、基板表面に薬液を塗布する薬液塗布機構と、薬液の回転塗布中に基板外部に排出される余剰の薬液が固形化し、綿菓子状の薬液が発生し得る領域に対して、前記薬液を除去する薬液除去溶剤を噴霧可能な薬液除去溶剤噴霧機構と、を備える。